

LPCVD化学相沉积设备

产品名称	LPCVD化学相沉积设备
公司名称	青岛育豪微电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭工业园协荣路3号
联系电话	0532-87671566 13864877323

产品详情

用途：用于半导体器件工艺中氮化硅、二氧化硅、多晶硅的薄膜制备

特点：一次设定自动完成，可另配气柜。真空系统可选配进口机组

主要技术指标：制备3-4吋氮化硅、多晶硅和二氧化硅薄膜；温度：400~900℃；

恒温区600mm±0.5mm；真空系统机械泵+罗茨泵，配有抽气冷井；

控温器采用进口5吋触摸屏；通入气体 $\text{SiH}_4/\text{NH}_3/\text{N}_2$ ；

进口质量流量计控制；阀门用进口气动阀和减压阀；动作顺序为plc编程控制；

薄膜压力控制器加阀闭环控制压强